



(Japan)

EVG Announces Mass Production Nanoimprint Equipment for 300mm Wafers / 2G Panels – June 20, 2021

EVG、300mmウェハ/2Gパネルに対応する量産対応ナノインプリント装置を発表



半導体製造装置メーカーであるオーストリアEV Groupは、ステップ&リピート・ナノインプリント・リソグラフィ(NIL)の新製品としてマスタースタンプ製造用「EVG 770 NT」を発表した。理科大、ナノインプリント用レプリカモールドの転写寿命の評価法を開発

同装置、ウェハレベル・オプティクス(WLO)、および高精度のラボ・オン・チップデバイス(マイクロ流体デバイス)、拡張現実(AR)ウェーブガ

<https://gunosy.com/articles/aJMHv>